

R&D・知的財産戦略

ウェブサイトの「研究・技術開発」もあわせてご覧ください。



● 使命

作る化学、混ぜる化学、考える化学の共創型研究開発により、世界No.1技術・製品を生み出し続ける。
「技術の染み出しによるイノベーションの実現」「事業本部を横断する技術開発のけん引」「社会を変える長期R&Dの推進」を実現する。

2030年ありたい姿

- 社会、市場、顧客に寄り添った技術・ソリューションを提供している
- 社内外の技術課題に取り組み、解決し、不断のイノベーションの実現をけん引している
- 長期的視点の研究開発活動を深化させ、真に持続的な社会に貢献できる技術を生み出し続けている
- 研究開発活動を担うリーダーやプロフェッショナルを継続的に輩出している

取り組むべき課題

- 社内外オープンイノベーションによる共創型研究開発の促進
- 新技術発掘検証に向けた研究開発の体制・運用の整備
- 全社共通基盤技術の高度化および利活用の活性化
- 経営および事業に資する攻めの知財活動の共創と強化

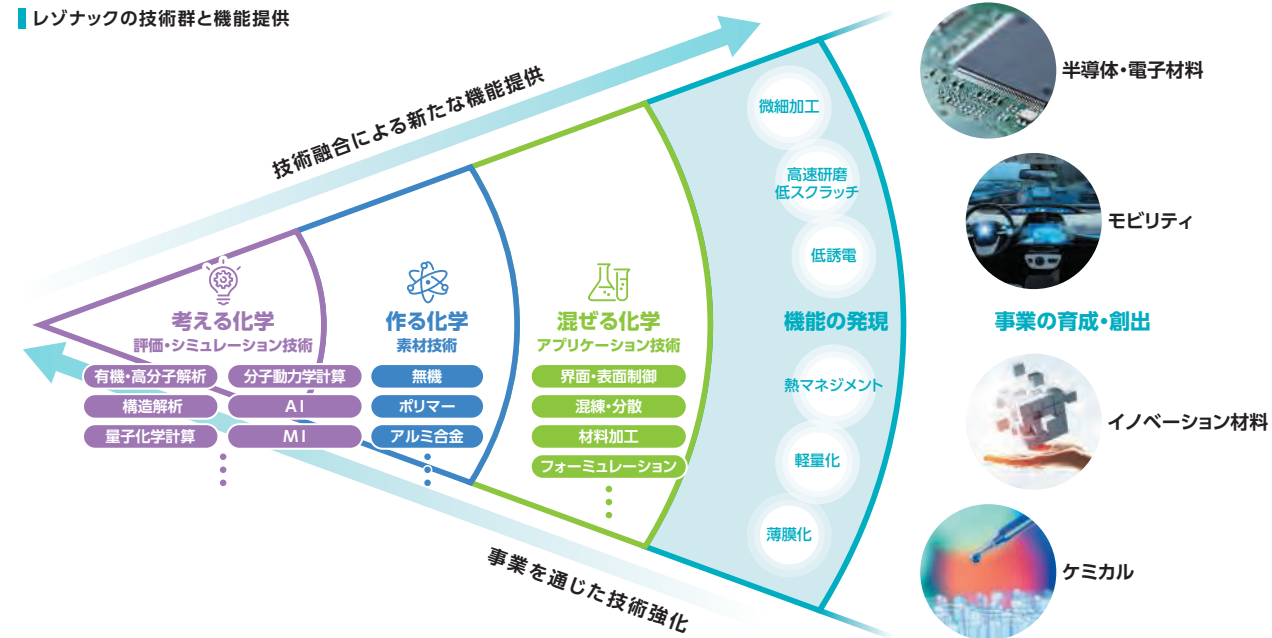
非財務KPI

- 社内外との共創
- R&D戦略と知財戦略の強化
- 人材育成

[P84 / 非財務KPIの実績と目標](#)

2023年実績	2024年計画
<p>事業部間(垂直・横断)連携:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 共創イノベーションの推進として、半導体分野に向けた先端材料開発を推進し、複数テーマを事業部プロジェクト化 	<ul style="list-style-type: none"> ● R&D一体運営・事業本部間の共創促進／半導体分野に向けた材料開発の加速、拡充、垂直・横断連携
<p>全社共通基盤技術:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DXの深化により、計算科学の活用とデータ駆動型R&Dによる研究開発を加速 	<ul style="list-style-type: none"> ● 計算科学／生成AIの活用とデータ駆動型R&DによるDXの推進
<p>新技術探索:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 社内外とのオープンイノベーションの積極的活用の場として、共創の舞台内に専門チームを創設 ● カーボンニュートラル実現に向けて、研究シーズ探索活動強化／事業部間連携連絡会の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ● 共創の舞台の活性化 ● 「研究ゲートアイランド」と研究所「技術ランドマーク」の整備・運用開始 ● カーボンニュートラル分野における研究開発部門と事業部間連携の強化／研究開発活動加速
<p>攻めの知財活動の共創と強化:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事業別知財ポートフォリオの可視化・強化と、事業優位性を確保するための積極権利活用を事業部と協働 	<ul style="list-style-type: none"> ● 事業部との協働による他社けん制効果の高いグローバル知財網形成、知財ポートフォリオの高質化、および積極活用
<p>人材育成:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 研究開発活動をけん引するリーダーやコア技術開発を担うプロフェッショナルの育成計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> ● 研究開発部門に所属する一部経営職に対し、バリューに沿った行動ができているかどうかを自己認識し行動変容の機会とするための360度フィードバックを実施

レゾナックの技術群と機能提供



新材料・新技術の注力領域

当社は、新材料・新技術の創出において、高速通信、パワー半導体、革新素材を2024年の注力領域とし、光電融合、次世代通信、接合技術、環境対応など革新技術の研究開発を進めます。

さらに要素技術となる、低誘電化、分散・混練、熱マネジメントやその評価プロセス、背反特性解消技術を着実に深化させ、製品開発サイクルを円滑化させます。

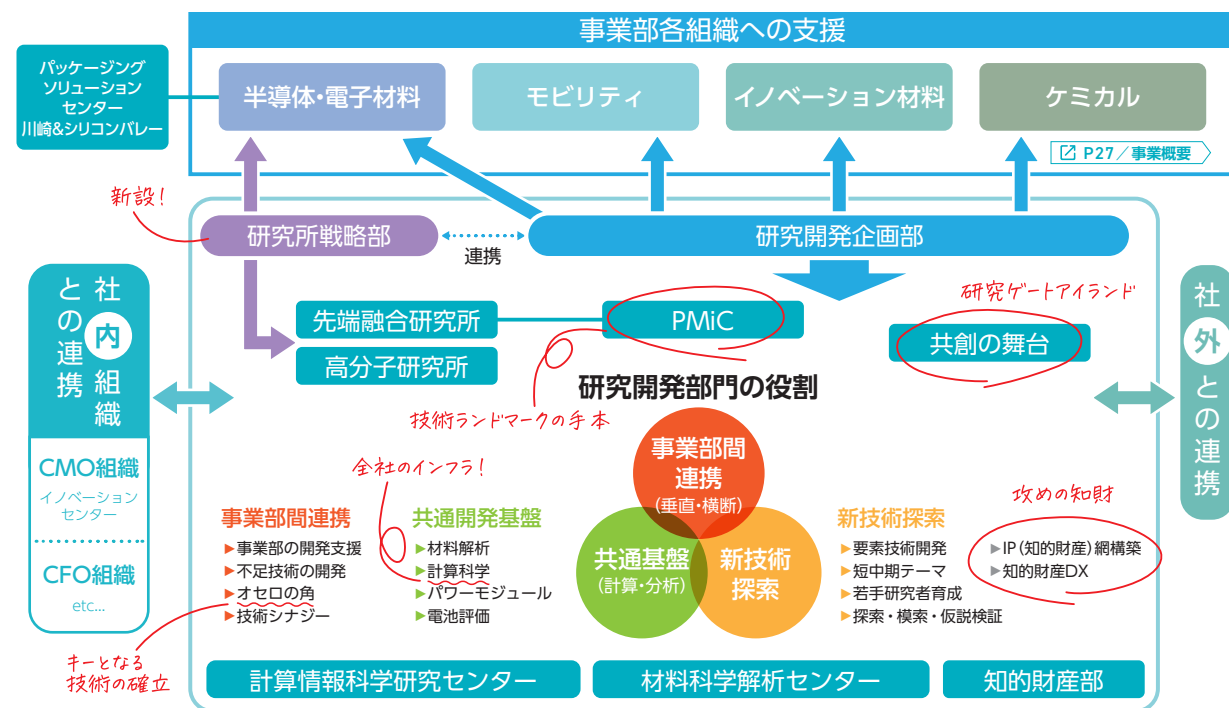
	高速通信	パワー半導体	革新素材
領域			
開発技術	<p>革新技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 光電融合 ● 次世代通信 <p>要素技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 低誘電化技術 ● 分散・混練技術 	<p>革新技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 低コスト接合技術 ● 異種材料接合技術 <p>要素技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熱マネジメント技術 ● 評価プロセス 	<p>革新技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 環境対応技術 <p>要素技術</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 背反特性解消技術
開発事例	 光電融合用接着剤 新規高熱伝導ファイバー	 焼結銅 異種材料接合技術	 低融点ガラス 低弾性低収縮樹脂

R&D・知的財産戦略

社内外との共創

研究成果の顕現確率を向上させることを目指し、事業部各組織、社内組織、社外のステークホルダーと連携し、共創を進めています。特に当社が注力する半導体・電子材料セグメントと研究

開発部門とのさらなる連携を図るため、2024年に研究所戦略部を新設しました。半導体パワーエレクトロニクス戦略、新テーマ、新製品開発と要素技術開発の戦略立案などを担っています。



TOPICS

宇宙で活用する技術を従業員自主活動から創出

当社は、JAXAが募集した「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・領域拡大に向けたオープンイノベーション」に、月の砂を利用した月面での蓄熱・熱利用システムに関する提案を行い、「チャレンジ型」枠で採択されました。この研究は、REBLUC*に参加する当社従業員が提案したもので、2024年4月よりJAXAと共同研究を開始しています。



*REBLUC: Resonac Blue Creators, レブルック: 若手インフルエンサー育成を目的とした社内コミュニティ

カーボンニュートラル実現のためのシナリオ

2050年カーボンニュートラルに向けた技術開発シナリオを策定し、石油化学・化学品事業を皮切りに革新的な技術開発を進めています。このうち、CO₂分離・回収技術では、既存材料と異なるCO₂吸着特性を有する分離剤を採用し、分離コストの低減を推進しています。世の中に先駆けて成果を社会に普及させることで、技術の汎用化・標準化において有利な立場を確立するとともに、知財戦略を推し進め、他社に模倣されない技術の優位性を訴求していきます。

共創の場

EVパワー半導体関連の材料開発強化
パワーモジュールインテグレーションセンター (PMiC) がお客さまに最適な材料を提案

当社が2023年に開設したPMiC(栃木県小山市)では、パワーモジュール向けの高耐熱コーティング材料や高放熱冷却器といった関連材料をそろえ、お客さまの条件での材料評価を行っています。検証内容の共有によりお客さまに最適な材料を提案し、素材開発までさかのぼった技術革新の支援と開発期間短縮に寄与しています。2024年中にお客さまとの共創スペース拡充や新たな装置の導入も予定しています。

PMiCは、アプリケーション視点の共創プラットフォームの場であり、パワーモジュールや電池評価、シミュレーションを中心とした計算科学、材料要素技術、分析を中心に関連する事業部との連携を強化しています。カーボンフットプリントの低減など、モジュール売り強化のための先回り提案を進めていくことにより、事業部門を研究開発側面から支援します。



必要な性能を発揮する素材・部材の「組み合わせ」を丸ごと提案
パワーモジュール素材の開発からお客さまの採用までの期間短縮

計算情報科学を使用した共創事例

計算情報科学研究センターは計算科学(分子シミュレーション、構造・流体シミュレーション)、情報科学(AI、MI*、画像解析、自然言語処理、データ活用基盤開発)技術を一カ所に集約する組織で

す。全事業セグメントのインフラとして、レゾナックを世界トップクラスの機能性化学メーカーとするミッションを担っています。ここに社内外の共創事例や成果を紹介します。

ディープラーニングを用いた画像解析を活用し
材料検査の自動化を実現

計算情報科学研究センターの画像解析専任チームと、実際に運用する製造現場との共創により、材料検査の自動化と検査時間の大幅短縮を実現しました。



AI・ディープラーニングを活用して
材料の開発期間を大幅に短縮

過去の材料開発から蓄積された計算および実験データを活用したディープラーニング技術を利用し、量子化学計算に比べて数千倍速く物性を予測することが可能になりました。



半導体材料メーカーで国内初、
仮想現実 (VR) を製品開発に活用

"分子レベルでの解析"を体感できることで、"材料開発の専門家"と"計算科学の専門家"のコミュニケーションを円滑化し、研究開発の加速につなげています。



マテリアルズ・インフォマティクス共創:
Matmerize社&Enthought社

2023年より、米国のスタートアップ2社と連携し、計算科学・AI・MIの活用に注力して、材料開発の迅速化を図るために共創を進めています。



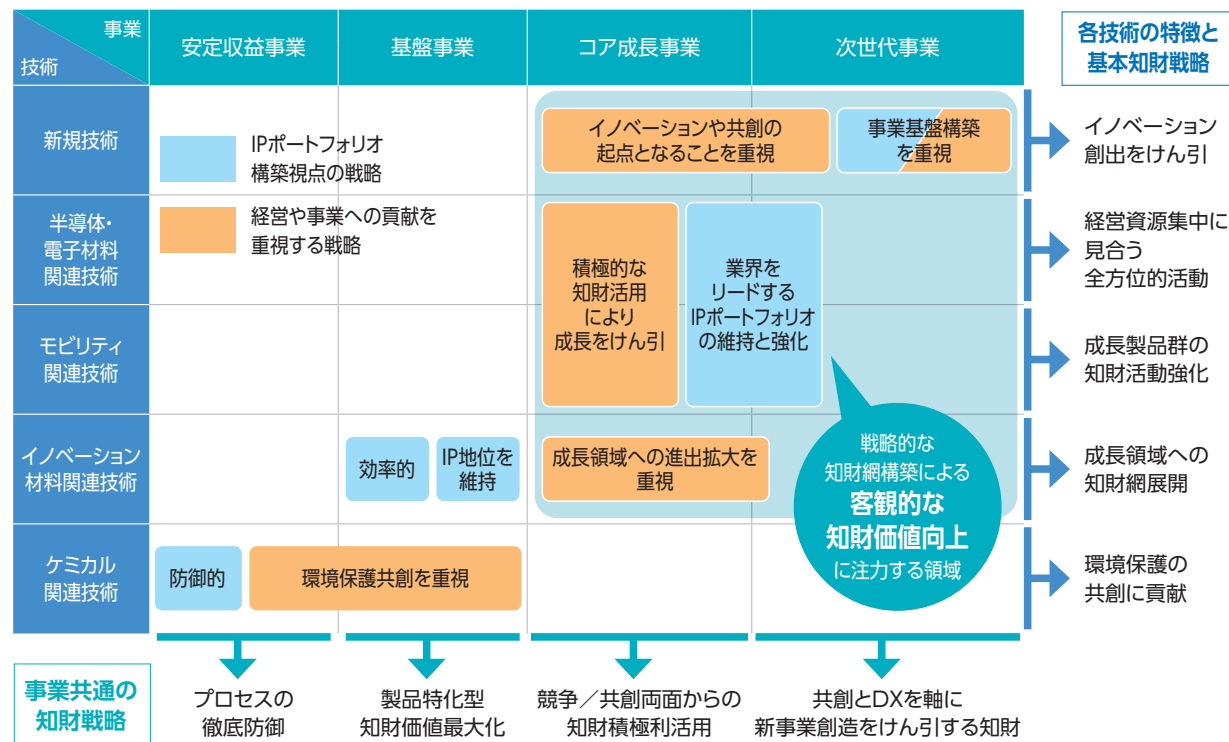
* MI: Materials Informatics

R&D・知的財産戦略

知財価値向上の取り組み

知的財産戦略

当社は、全社の事業ポートフォリオを俯瞰し、グローバルな特許出願などを通じて、各事業に最も適した知財ポートフォリオの構築を追求しています。さらに、知的財産の積極的利活用をはじめとして、経営および事業に貢献し、競争力の強化と持続可能な成長を実現する知財戦略を策定のうえ、遂行しています。



新規技術や半導体・電子材料関連技術をはじめとするコア成長事業および次世代事業に関しては、業界をリードする強力な知財ポートフォリオを構築し、知財価値を客観的に向上する取り組みを進めています。さらに、当事業の成長をけん引する積極的な知財活用方針として“攻めの知財”を掲げ、持続的な収益の向上を試みています。2023年には、当社の感光性フィルムに関する特許権に基づき、海外4社に対し販売差し止めと損害賠償を求める訴訟を提起しました。また、当社の成長けん引のための共創を促進させることを視野に入れた知財戦略も構築中です(詳細はP70:TOPICS参照)。

一方、安定収益事業や基盤事業では、事業運営の安定化に資す

る知財戦略を実行しています。ケミカル関連技術では、適切な範囲の知財権取得と徹底した情報管理によってプロセスやノウハウを保護する防衛的活動のほか、KPR(使用済みプラスチックの原料化事業)といった環境保護活動における共創に貢献するための知財ポートフォリオ構築を進めています。また、イノベーション材料技術に関しては、改良発明出願をはじめとした当社の知財地位を維持する活動のほか、成長領域への進出を知財面から支援する知財戦略を推進しています。

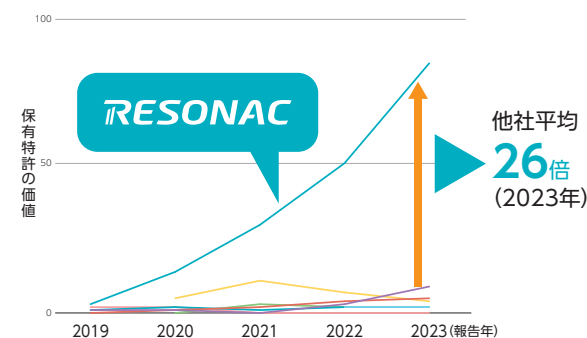
事業戦略に沿ったこれらの取り組みにより、当社の技術価値および企業価値を最大化してまいります。

IPランドスケープの事業への活用および知財価値評価

当社は、知的財産部門、事業部門、研究開発部門などが連携し、当社保有の知的資産を可視化し、各技術領域における当社の位置づけを明確にするため、IPランドスケープを活用しています。また、研究開発分野だけではなく、当社・顧客製品の用途開発・機能拡大にもIPランドスケープを活用し、新たな市場ニーズを探求しています。さらに、購買・調達部門でも、新規サプライヤーの発掘と各企業の技術力の評価にIPランドスケープを活用しています。

当社はまず、トップクラスの日本企業と同等の知財価値を持つことを中間目標とし、最終的にグローバルトップ企業と肩を並べることを目標としています。

マテリアルズ・インフォマティクスに関する保有特許の価値(競合他社との比較)

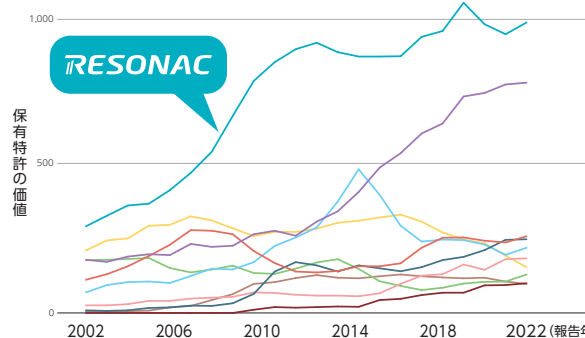


*LexisNexis社の特許データベースを用いた有効特許に対する評価であり、PAIIは、各特許の技術的価値(Technology Relevance)と市場的価値(Market Coverage)を基に算出

当社の重点テーマの一つである、計算情報科学のマテリアルズインフォマティクス分野に関する当社の保有特許の価値(PAI = Patent Asset Index*: LexisNexis社の商標)は近年顕著な増加傾向を示しています。2023年には他社平均の26倍に達しており、当社の競争優位性を示しています(下記、左グラフ)。

また、次世代半導体パッケージに関する当社の保有特許の価値、2002年以降増加し2010年代以後一定レベルの価値を維持しています(下記、右グラフ)。今後、グローバル出願戦略をより精密化することで市場の価値を高めることに加え、重要な研究開発成果を“早期かつ”多面的・重層的”に出願することを通して、当社の知財ポートフォリオをさらに高質化していきます。

次世代半導体パッケージに関する保有特許の価値(競合他社との比較)



TOPICS

全方位的な共創視点による知財ポートフォリオの形成

当社は、新事業の着想段階から、共創に資する広範囲な知財ポートフォリオ形成つなげる知財活動を心掛けています。これまで、競合会社の排除や金銭的収入を目的とした知財ポートフォリオの形成と活用が中心でした。今後はこれに加えて、多様な企業、地域、お客さま、サプライヤー、スタートアップおよびアカデミアを含めた全方位的な共創視点を持って、知財ポートフォリオを形成し、活用していきます。これにより、新たなビジネスに関わるあらゆるステークホルダーとの共創を誘引するだけでなく、規格標準化といった新たな機会を見つけ出すことも可能になると考えられます。

具体的な取り組みとして、2023年には、環境技術に関する知的財産の登録を通じて共創を促進することを目指し、世界知的所有権機関(WIPO)が運営する環境技術のグローバルプラットフォーム「WIPO GREEN」にパートナーとして参画しました。



コーポレートマーケティング戦略

● 使命

社会やお客さまが抱える課題を特定し、当社の強みである技術をもって解決する提案活動を通して、お客さまの成長とともに持続可能な社会を築く。そのために、社内のマーケティングや事業創出に関するスキルアップや人材育成を主導する。

2030年ありたい姿

- 社内外の共創により次世代事業を創出している
- デジタルを活用して、効率的なマーケティング活動をしている
- 組織横断でのローテーションによる人材と組織力強化

市場や顧客の困りごとを解決できる提案が当社の価値。技術や製品・サービスを生み出す活動をけん引し、お客さまとその先のニーズに目を向けた提案を強化していきます。



CMO 藤田 茂

取り組むべき課題

- 課題解決型マーケティング活動の浸透による持続可能な成長
- 顧客(市場)・技術・事業をつなぐ社内外の連携プロジェクトを創出
コーポレートマーケティング部門が各事業部門のマーケティング活動強化に向けた支援を行い、事業間の連携を促進するなど、事業横断的なマーケティング活動を実施。また、研究開発部門との連携を強化することで、事業と技術をつなぐ機能として潜在市場ニーズと研究技術シーズのマッチングを強化し、価値を提案
- 顧客ニーズ、市場トレンドと自社技術を理解した事業開発能力を持つマーケターの育成
マーケティング部門および営業部門のマーケティング育成プログラムを実施し、バリューチェーンを理解した人材を育成することで、事業開発能力を向上させる

非財務KPI

- 課題解決型マーケティングの浸透による大型案件創出
 - デジタルプラットフォームの活用
- [P84 / 非財務KPIの実績と目標](#)

2023年実績

市場開拓

- お客さまとの共創活動の推進
- 新規テーマの事業化推進
- 新規大型テーマ創出プロセスの見直し

デジタルプラットフォーム

- 事業部との連携によるデジタルマーケティング活用
- CRM*ツールの普及

2024年計画

- お客さまとの共創による次世代テーマ向け提案
- 新規テーマでの事業化
- 新規テーマ創出プロセスの運用開始
- マーケター育成プログラムの実行

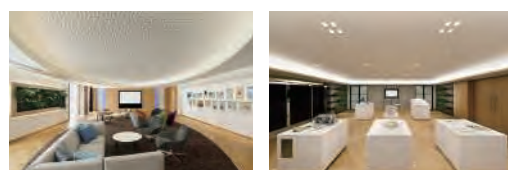
- デジタルマーケティング・CRMツールのグローバル展開

*CRM:Customer Relationship Management

共創の場

ステークホルダーとの新しい共創のきっかけや関係強化を図る場として、東京駅八重洲南口徒歩2分のパシフィックセンチュリープレイス丸の内29階にイノベーションセンターを設置しています。

双方向のコミュニケーションにより新テーマを探索することを目的としており、当社コア技術の体験型展示も用意し、お客さまや取引先など、多様なステークホルダーとのイノベーション共創を目指しています。



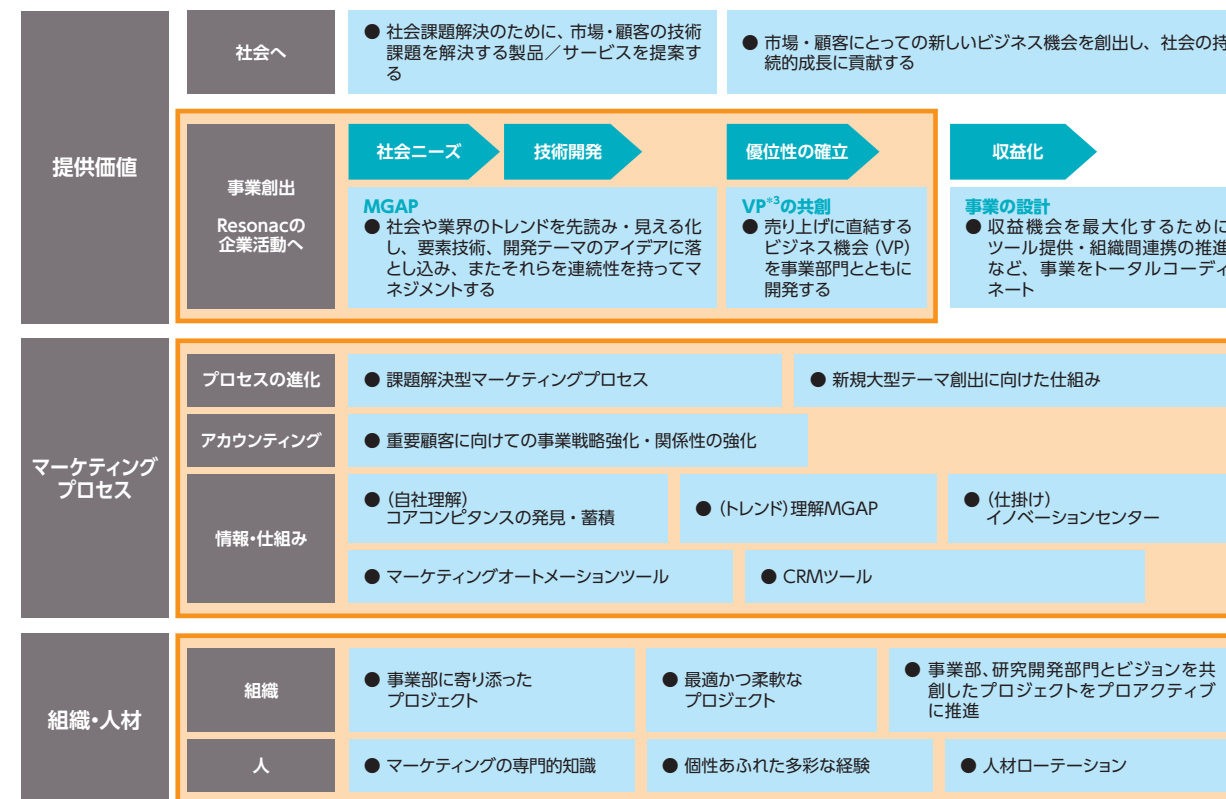
イノベーションセンター(東京都千代田区)

課題解決型マーケティングプロセスの推進

社会や市場トレンドを先読みしてお客さまの技術課題を特定する「課題解決型マーケティングプロセス」の推進により、その課題解決に貢献する要素技術開発やビジネス創出を目指しています。MGAP*1を用いてお客さまが直面している技術課題を抽出し、提供価値を自社製品の特長、競合技術との差別化、お客さまが得る便益で整理して、提案活動を進めるとともに、MA*2やCRMの

デジタルツールの運用浸透によりマーケティング活動の効率化と成果可視化を進めています。

また、課題解決を持続的に提案できるプロセス基盤の構築と並行して、一連の提案活動を自律的に推進できる人材育成に注力しています。



*1:MGAP:Multi Generation Application Planning *2:MA:Marketing Automation *3:VP:Value Propotion

TOPICS

お客さまとの共創:パワーモジュールでの次世代向けの提案の促進

当社は、お客さま起点での課題解決に取り組んでおり、その一例として、次世代のパワーモジュール技術の発展を目指し、パワーモジュール関連材料の提案力の強化に取り組んでいます。課題の解決に向けては、主要顧客と共創を進めるとともに、材料開発力とパワーモジュール評価技術力を備えた「パワーモジュールインテグレーションセンター(PMiC)」を活用し、モジュール評価を迅速かつ効率的に行っています。これらにより、コーポレートマーケティング部門、PMiC、各事業部が丸となって、個の材料の強化・幅広い材料提案・組み合わせをお客さまに提案し、共創による課題解決を実施しています。

[P68 / R&D・知的財産戦略](#)

デジタル戦略

● 使命

デジタル技術とデータを、高度に、かつ徹底して活用することで、社内および社外との業務プロセスを進化・洗練させ、組織文化の変革をリードする。また、要となるデジタル人材の育成と適切な配置によって、継続的に業務を改善・改革し、ステークホルダーと共に社会に貢献する。

2030年ありたい姿

- あらゆる事業・業務でデジタル変革を進め、2030年には、競争力の源泉であるコア業務にリソースを集中。ステークホルダーとの共創を進め、高い社会価値の創造に貢献している。また、定型業務や間接業務の自動化が進んでいる

取り組むべき課題

短期 (2024年-2025年)

- TCO¹最適化、IT/DX基盤の再構築
- 事業部・事業所との連携強化
- 先進的なデジタルツールの活用促進

長期 (2026年-2030年)

- 基幹システムの見直し
- データ利活用による業務高度化
- 事業の新ビジネスモデルを共創

非財務KPI

- データドリブン経営
- DX推進とプロフェッショナルの育成
- IT/デジタルリテラシー向上

[P84 / 非財務KPIの実績と目標](#)

2023年実績

- 経営会議にてデータ可視化ツール(BIツール)を活用し、経営数値を可視化、分析を開始
- GHG可視化・削減に向けたプロセス設計を開始
- CDO組織内の人材に対し、IPA²提唱の「i コンピテンシ ディクショナリ」をもとにIT/デジタル人材の役割定義が完了
- AMI社のAIを活用した画像認識技術、シミュレーション技術を有するデジタル人材を戦力として活用

2024年計画

- IT/デジタル活用の実現に向けて、基盤整備と体制強化
- IT/DXビジネスパートナーによる事業部・事業所との連携強化
- 先進的なデジタルツールの活用支援(AMI社とのシナジー創出、ChatGPTなどデジタルツール活用促進)

*1:TCO:Total Cost of Ownership *2:IPA:Information-technology Promotion Agency, Japan(情報処理推進機構)

デジタル人材の育成にも注力!

全従業員向け人材育成

IT/デジタルを活用できる人材を育成するために、IT/デジタルリテラシーレベルを4段階で定義しています。2023年度はレベル1(探求初期)として、全従業員に対してIT基礎教育プログラムを提供しました。2024年度には、レベル2(日常使用)とレベル3(業務活用)に意識を向け、導入済みのIT/デジタルツールの活用に重点を置いた教育プログラムを実施します。さらに、現場でIT/デジタルの活用を主導する人材に対しても、教育や人材育成に力を入れて取り組みます。

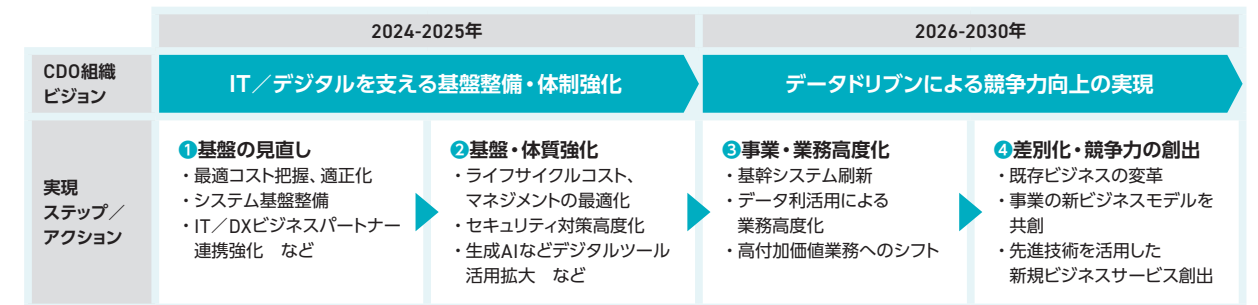
専門人材向け人材育成

IT/デジタルの専門人材に対しては、アセスメントを実施し、スキルの可視化を行います。また、専門性に合わせた高度なIT/デジタルの教育プログラムを提供し、さらなる成長を支援します。さらに、人材ポートフォリオを作成し、事業に必要な専門人材の育成計画を策定します。

デジタル変革における戦略と実現ステップ

当社は、業務システムをオープンでセキュアなアーキテクチャに刷新し、データを効率的に管理できる状態を目指しています。まずはIT/デジタル活用の実現に向けて、基盤整備と体制強化を行います。さらに、データに基づく競争力の向上を目指します。

これらの目標を達成するために、IT/DXビジネスパートナーを配置し、IT/デジタルと現場を連携させ、構想・計画策定、システム導入、業務改善などの課題解決に取り組みます。



共創事例

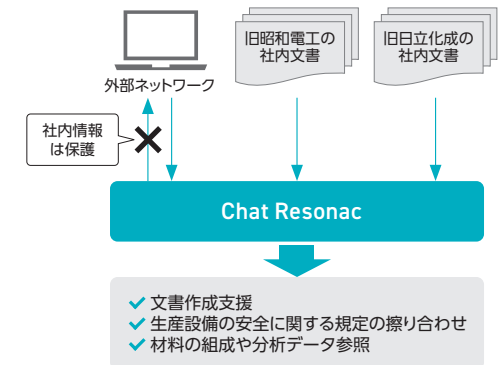
生成AI Chat Resonac (チャットレゾナック) を構築

当社は、ChatGPTの当社専用環境である生成AI Chat Resonacというシステムを構築し、材料開発や製造などに関する手書きも含めた膨大な情報から、必要な情報を容易に探し出すことを可能にしました。社内システムのため、情報漏えいのリスクがなく、従業員が安全・安心に利用できることが特徴です。従業員が普段の業務でスムーズに活用できるよう、使用方法のトレーニングや活用方法の共有など、適切なサポートも提供しています。

開発担当者と現場従業員との密な情報交換と、相互理解が進んだことも大きく寄与し、今回のシステム構築に至りました。この全社型システムに加え、計算情報科学研究センターが中心となり、社内文書の活用もできる特化型Chat Resonacの実証実験も進められています。

生成AIのメリットを最大限に享受し、より効率的かつ創造的な業務を実現するために、Chat Resonacの普及と活用を積極的に推進していきます。

生成AIの活用イメージ



品質異常解析の精緻化にAIモデルを適用し、歩留まり向上の検証を開始

事業部では、お客さまからの品質に対する要求の高まりにより、カスタマーサポートの迅速化・詳細化が求められています。例えば、ある事業部では、製品品質異常への要因解析時間の短縮と精緻化が課題となっていました。この課題に対し、機械学習を用い、工程、材料情報、検査情報から、高い精度で製品品質を予測するAIモデルを構築するなど、課題解決に向けデジタル技術を駆使して事業部と共創しています。本モデルは、予測した品質に寄与したパラメータを特定する機能(解釈性)を有しており、人間に知見を与えることで、要因解析の時間短縮に寄与できます。現段階で本モデルをもとにしたプロトタイプが完成し、高い精度が得られています。今後も検証を継続し、2024年中に有用性を判定する予定にしています。

人材戦略

方針や推進体制、活動の詳細はウェブサイトをご覧ください。



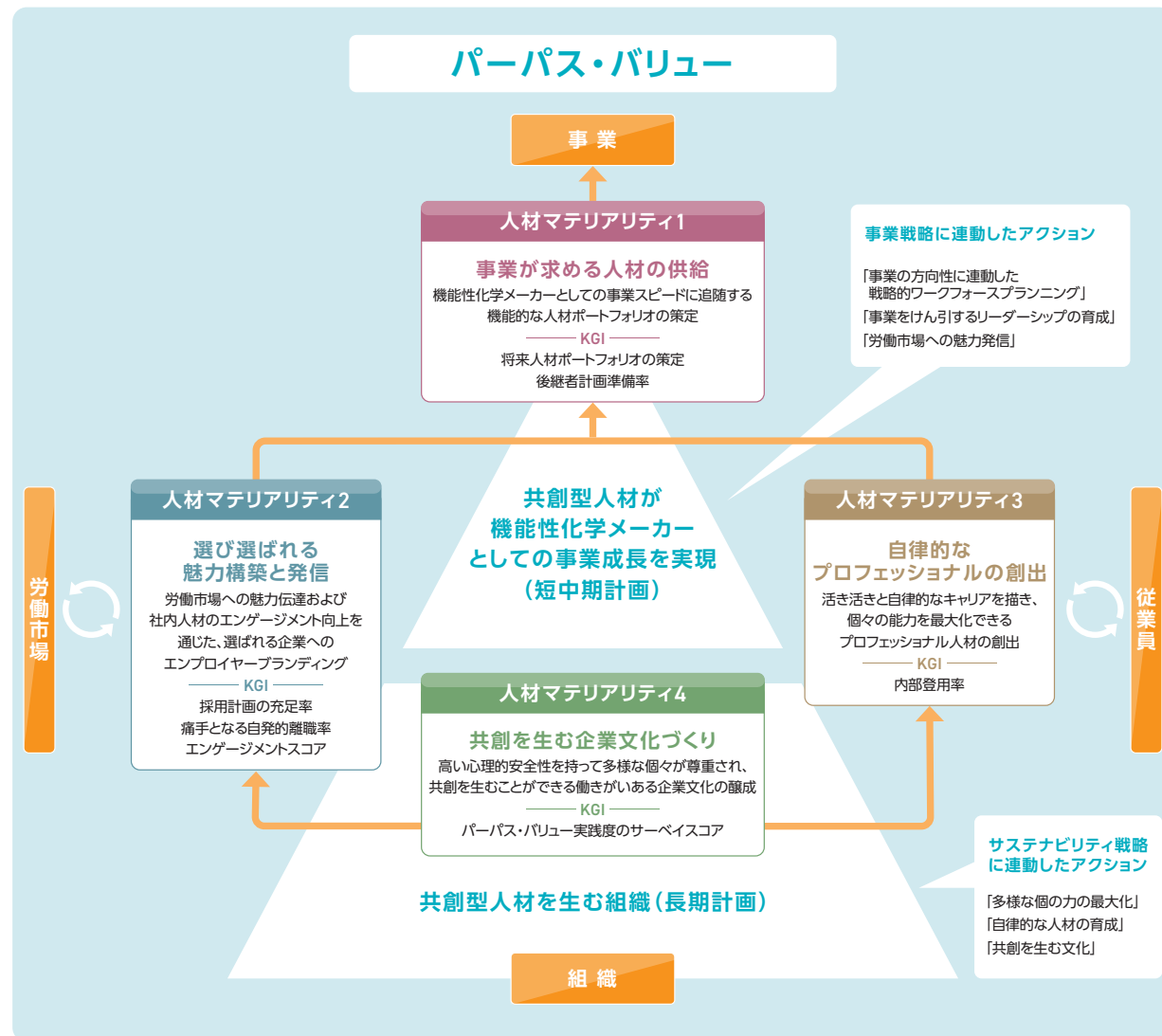
● 使命

当社の企業価値向上のため、事業戦略（ポートフォリオ戦略）と人材戦略を完全に合致させることが必要不可欠。パーパス・バリューの実践によるレゾナックならではの共創文化を醸成し、共創型人材*を創出することで、事業のさらなる成長を実現する。

*共創型人材：社会課題の解決に向け、社内外の人々と自律的につながり、共創を通じて創造的に変革と課題を解決できる人材

取り組むべき課題（人材マテリアリティ）とKGI

マテリアリティ「自律的・創造的な人材の活躍と文化醸成」および事業戦略に連動している、4つの人材マテリアリティを核に、長期では共創型人材を生む組織づくり、短中期では共創型人材が機能性化学メーカーとして事業成長を実現するための施策を進めていきます。



▶人材マテリアリティのKGI/KPIはこちら [P86 / 非財務KPIの実績と目標](#)

*一部のKGI/KPIの実績値・目標は現状非開示とし社内にて進捗管理しています。

当社の価値の源泉は、幅広い技術プラットフォームをベースに、異なる技術を組み合わせ“機能”を生み出す“人材”です。共創型人材育成に取り組む上で、特に力を入れて取り組んでいる、エレクトロニクス事業本部での人材ポートフォリオ戦略を紹介します。



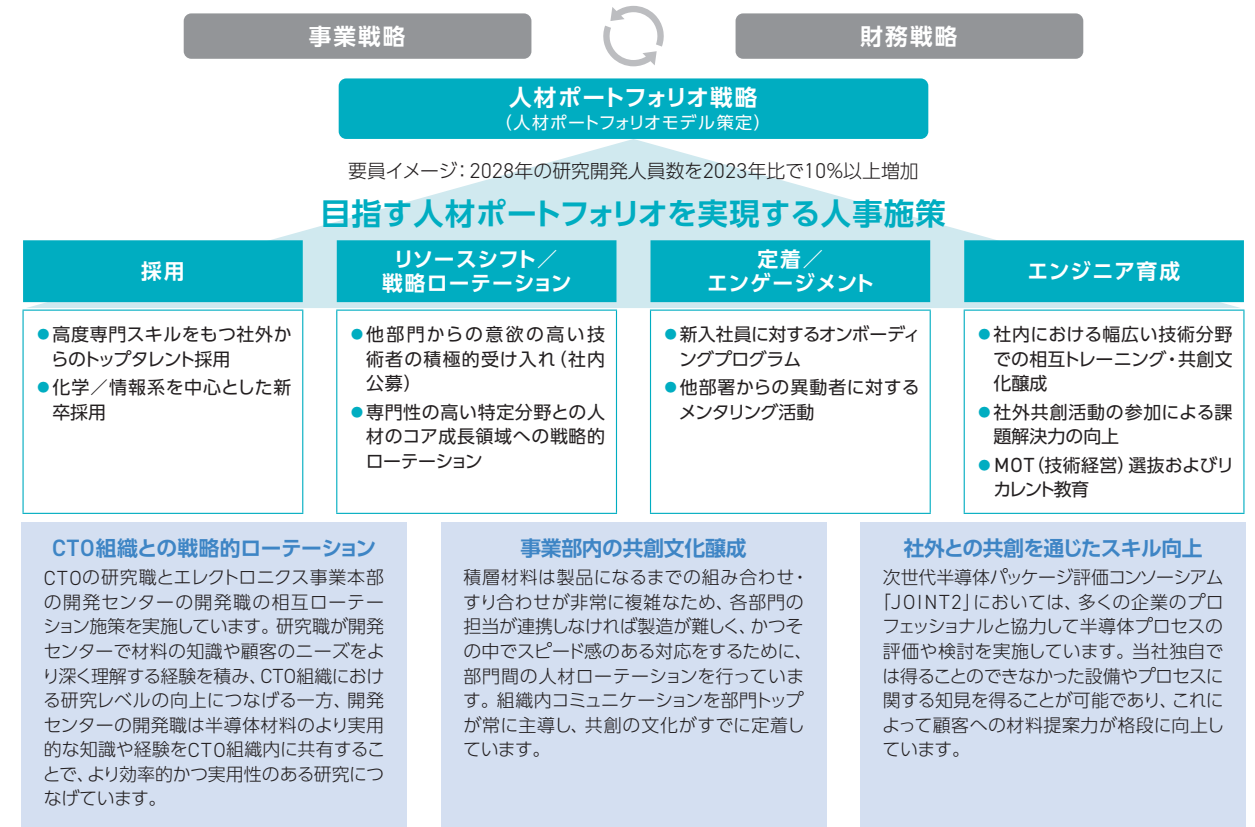
CHRO 今井のり

● 事業戦略と連動した人材ポートフォリオ戦略

当社は、各事業のありたい姿を実現するため、職種別に求められるスキルやコンピテンシーを整理・定義し、求める人材の充足状況に応じた人員計画を策定しています。

例えば、コア成長事業である半導体材料事業を担うエレクトロニクス事業本部では、開発エンジニアの役割を細分化し、独自の人材ポートフォリオモデルを策定しています。これを基に、5年後の目指すべき事業の人員構成を定め、現時点のギャップを明らかにしたうえで、採用・リソースシフト・定着／エンゲージメント・エンジニア育成の各分野に関する施策を実行しています。

■ エレクトロニクス事業本部の例



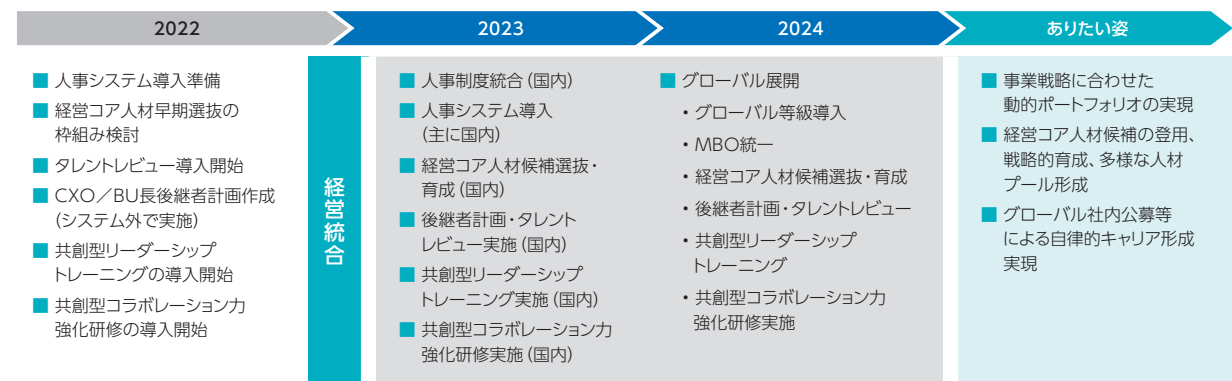
CTO 福島 正人

研究開発においてもより顧客に近い経験が、パーパス“化学の力で社会を変える”の実現への力になります。これらの取り組みは [P59](#) で鼎談していますので、ぜひご覧ください。また、事業における開発だけでなく、マーケティングの経験などを積む研修も計画中です。

人材戦略

当社はグローバル全体における最適な人材マネジメントを行うための各人事施策の実行を加速させています。特に2022年から2023年にかけては人事制度の統合やタレントマネジメントの仕組みの構築、人事システムの導入などの主要な人事施策の変革を実施しました。経営統合に合わせ極めて短期間で一気に全体を刷新し、すでに運用を開始しています。

人事施策の実行スケジュール



経営コア人材の育成やタレントレビュー、後継者計画などの施策については、グローバル標準の人材マネジメントシステムを導入し、人材のデジタル基盤を確立するとともに、施策に合わせてデータを活用できる仕組みを構築しています。

2023年までは主に国内を中心に実施してきたこれら各施策について、2024年からはグループグローバル全体での展開を進めています。

重点施策① 共創型人材を育成するリーダーを育てるために「共創型リーダーシップトレーニング」

人材育成力の高い組織を目指して、共創型リーダーシップトレーニングを2022年10月より実施しています。2024年5月末時点の受講者数は1,448名。部下を持つマネージャーや、OJTなどで後進の育成にあたる非管理職の社員も多数受講しています。

共創型リーダーシップトレーニングはレゾナック設立前に行われたエンゲージメントサーベイの結果を受け、ピープルマネジメントの基本的な知識・スキルの再学習・実践確認のために実施しており、MBOの理解や、効果的なOJTのポイント、適切なフィードバック・コーチングについて学習する内容です。

研修内に豊富に設けられたグループワーク、ロールプレイにより、理解だけでなく、実践状況を参加者が振り返ることができる内容です。研修講師は社内講師が担当しています。

研修参加者向けのアンケートでは92%が研修内容に満足、95%が研修内容が有用であると回答、96%が学習内容を職場ですぐ

に実践するイメージが持てたと回答しています。

2024年から海外展開を推進しており、欧州、中国、米国、東南アジアで社内講師を育成し、トレーニングを実施しています。

今後もレゾナックグループの人材開発の土台となる施策として継続的に展開していきます。



ヨーロッパでの研修の様子

参加者の声

「演習が多く、非常に有意義な研修だった」
「1on1をベースとしたコーチングを体感し、有用性を再認識した」
「あらためてコミュニケーションの重要性、取り方の難しさを再確認した」

KGI/KPI	2023実績	2024目標	2025目標
マネジメント強化研修に参加したラインマネージャーの割合	70%	85%	90%

重点施策② 当社らしい人材戦略をグローバルで実行するために「グローバル等級・評価制度」

等級・評価制度を中心とした人事諸制度のグローバル展開の一つとして、グループ全体における経営職の等級(グローバルグレード)および評価制度(MBO)の統一を実施しています。

グレードや評価の仕組みを統一したことで、役割や評価におけるグループ共通の基準ができただけでなく、後継者計画や育成などのタレントマネジメントを含む、他の人事施策のグローバル展開の実行につながっています。なお、当社のMBOは「業績目

標に対する結果」だけではなく、「行動・成長」の側面を重視し、バリュウの実践度合いを合わせて評価します。

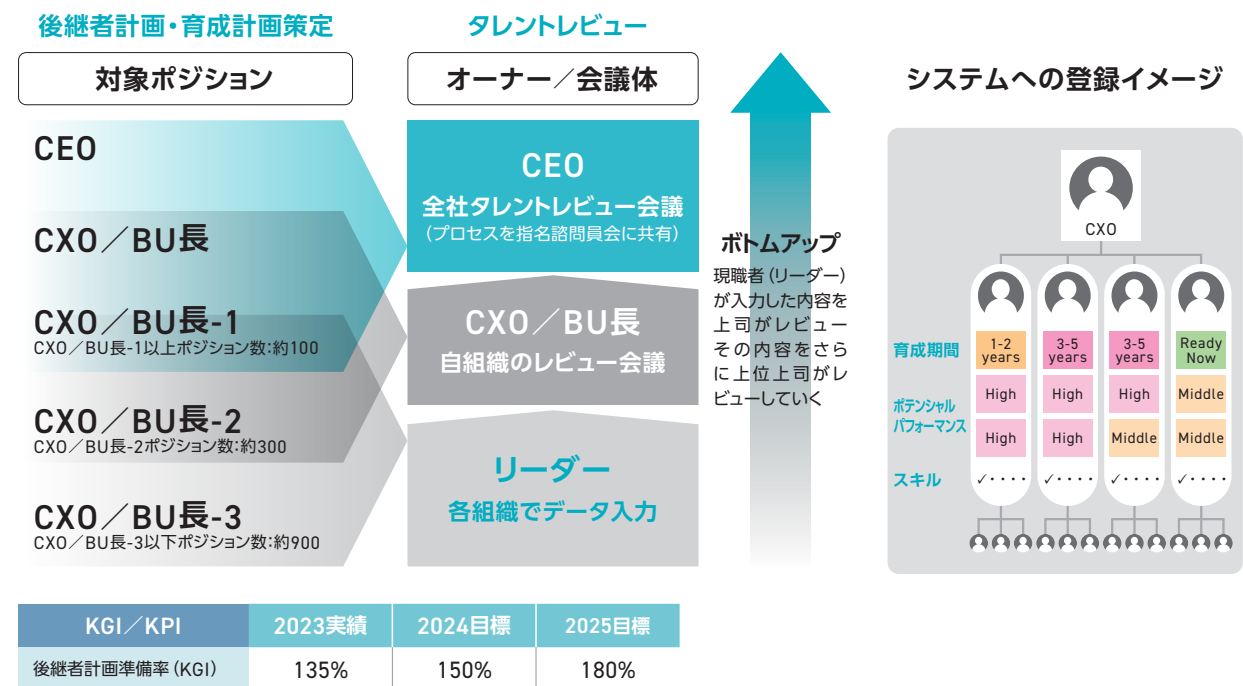
これにより、レゾナックグループ全体でバリュウの浸透・実践を促し、グローバル共通軸での人材・パフォーマンス管理の実現と、人事システムにおいても共通基盤の確立を進めることが可能となりました。

今後さらに施策を進め、グループ全体での適材適所を目指します。

重点施策③ 次世代を担うリーダーを育成するために「タレントマネジメント」

経営陣が全社最適視点で組織課題や後継者候補・次世代リーダー候補人材についてオープンに話し合う場として「全社タレントレビュー」の会議体を発足しました。各部門で作成した後継者計画の内容や人材育成方針について議論するとともに、グループ全体として管理するタレントプール(次世代リーダー候補者の母集団)の構築に取り組んでいます。2023年には、国内単体の全リーダーポジション(約1,300)を対象に、CEOをオーナーとするボトムアップでのタレントレビューを実施しました。その結果、

対象ポジションの約90%超にて後継者計画が策定され、システムへの登録が完了するとともに、職場単位で人材育成に関する議論が始まっています。今後は、グローバルに対象を拡大し、海外のハイポテンシャル人材の可視化や国を超えたアサイメントの適用の検討を開始します。また、タレントレビューについては、実施状況を指名諮問委員会に対し定期的に報告し、プロセスの妥当性を確認しています。



KGI/KPI	2023実績	2024目標	2025目標
後継者計画準備率 (KGI)	135%	150%	180%